

# 國立彰化師範大學科技研究總中心所屬共同儀器中心

## 儀器使用人員教育訓練與資格檢定 議程

課程名稱	奈米核心設施培訓研習會-光微影系統曝光機(Mask Aligner)
課程目的	為了讓使用者對本校奈米科技中心所購置的光微影系統曝光機(Mask Aligner)有更進一步的認識以及提高使用率，特舉辦本培訓研習會。
課程說明	課程分為原理講解課程以及上機操作訓練課程。 上機操作訓練課程報名者須 <b>事先通過無塵室及酸鹼處理室使用資格檢定</b> 並研習上午的原理講解課程才可參加。
開放對象	<input checked="" type="checkbox"/> 限本校教職員及學生 <input type="checkbox"/> 限本校教職員 <input type="checkbox"/> 不拘
儀器名稱 (中英文名稱)	光微影系統曝光機 Mask Aligner
儀器簡介	用於次微米線寬曝光製作。 將晶圓與光罩採真空吸附於晶圓座與光罩座上，對準光罩上之 align key 後，以紫外燈源進行光阻之曝光動作。其曝光模式有真空吸附、直接接觸及近接模式。
儀器照片	
課程時間	2013 年 9 月 3 日 (星期二)
課程地點	<input checked="" type="checkbox"/> 進德校區 <u>格致館一樓 811 教室；藝薈館B1 奈米科技中心</u> <input type="checkbox"/> 寶山校區 _____
報名方式	線上報名管理系統報名並請下載報名表，報名表填妥後以電子郵件傳送至 <a href="mailto:u9417802@cc.ncue.edu.tw">u9417802@cc.ncue.edu.tw</a> 潘昭倩小姐 收
報名期限	自即日起至 102 年 8 月 23 日截止。(依報名順序，額滿截止)
招收人數	原理講解課程：60 人 上機操作課程：共分三梯次，上限 15 人；每位指導教授限定 2 名學生報名。 惟因執行中心任務所需者，不受此限。

	收費	<input type="checkbox"/> 免費 (免填右方資料) <input checked="" type="checkbox"/> 需收費 (請填右方資料)	活動費用： 原理講解課程：免費 上機操作課程：1,500 元 繳費方式：現金繳納/計劃沖轉													
	課程表	<table border="1" data-bbox="451 331 1453 645"> <thead> <tr> <th data-bbox="451 331 710 383">講題</th> <th data-bbox="710 331 927 383">日期</th> <th data-bbox="927 331 1161 383">地點</th> <th data-bbox="1161 331 1453 383">主講人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="451 383 710 501">半導體製程與 曝光系統簡介</td> <td data-bbox="710 383 927 501">9/3(二) 9:00~12:00</td> <td data-bbox="927 383 1161 501">格致館 811 教室</td> <td data-bbox="1161 383 1453 501" rowspan="2">國立彰化師範大學 機電系 沈志雄 教授</td> </tr> <tr> <td data-bbox="451 501 710 645">曝光機操作訓練</td> <td data-bbox="710 501 927 645">9/3(二) 13:00~17:00</td> <td data-bbox="927 501 1161 645">藝薈館 B1 奈米科技中心</td> </tr> </tbody> </table>				講題	日期	地點	主講人	半導體製程與 曝光系統簡介	9/3(二) 9:00~12:00	格致館 811 教室	國立彰化師範大學 機電系 沈志雄 教授	曝光機操作訓練	9/3(二) 13:00~17:00	藝薈館 B1 奈米科技中心
講題	日期	地點	主講人													
半導體製程與 曝光系統簡介	9/3(二) 9:00~12:00	格致館 811 教室	國立彰化師範大學 機電系 沈志雄 教授													
曝光機操作訓練	9/3(二) 13:00~17:00	藝薈館 B1 奈米科技中心														
	檢定項目	曝光機上機操作 檢定項目:15 分鐘完成以下步驟 a. 開關機程序 (30%) b. 控制鈕了解與操作 (5%) c. 事前試片處理程序 (5%) d. 化學藥劑認知 (5%) e. 光罩擺放與清潔 (5%) f. 影像顯影曝光程序 (20%) g. 圖型完整性 (30%)														
	發證標準	上機操作成績達 85 分以上始達發證標準。														
	刊登報名訊息 (請勾選)	<input checked="" type="checkbox"/> 本校首頁-最新消息 <input checked="" type="checkbox"/> 科技研究總中心首頁-最新消息 <input checked="" type="checkbox"/> 本校線上報名管理系統 <input checked="" type="checkbox"/> 共同儀器中心首頁-最新消息														